

УДК 621.315.592; 535.33

Е. В. Лебедок, канд. физ-мат. наук;
Д. М. Кабанов, канд. физ-мат. наук; Р. Ю. Микулич, асп.
(ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», г. Минск);
Ю. П. Яковлев, д-р физ-мат. наук; Е. В. Куницына, канд. физ-мат. наук
(ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Россия, г. Санкт-Петербург)

ИЗЛУЧЕНИЯ ДИСКОВЫХ ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ GAINASSB/ALGAASSB ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 2,7–300 К

Создание спектральных приборов для медицины, экологии, промышленного мониторинга, изучении загрязнения окружающей среды на сегодняшний день является одним из важных направлений. Появление и разработка детекторов и анализаторов требует развитие полупроводниковых источников среднего ИК диапазона, работающих в широком интервале температур.

Исследуемые образцы представляют собой полупроводниковые лазерные диоды с дисковыми резонаторами. Гетероструктура лазеров выращена методом молекулярно - пучковой эпитаксии на установке RIBER Compact 21E на подложке n - GaSb (100) в организации соисполнителе проекта с российской стороны (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН). Активная область общей толщиной 750 нм состояла из двух напряженных квантовых ям состава $Ga_{0.65}In_{0.35}As_{0.11}Sb_{0.89}$, каждая толщиной 10 нм, разъединенных слоем $Al_{0.25}Ga_{0.75}As_{0.02}Sb_{0.98}$ толщиной 30 нм. Волноводные слои, изготовленные из $Al_{0.25}Ga_{0.75}As_{0.02}Sb_{0.98}$, имели толщину по 350 нм. Активная область преднамеренно не легированась. Волновод был ограничен широкозонными слоями p (Be) - и n (Te) - $Al_{0.9}Ga_{0.1}As_{0.08}Sb_{0.92}$ толщинами по 1,5 мкм. Для улучшения инжекции носителей заряда в активную область с внешней стороны широкозонных слоев были выращены два тонких, по 100 нм, варизонных слоя AlGaAsSb. Верхний контактный слой GaSb p-типа имел толщину 300 нм и был легирован до концентрации дырок $p = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$.

Для исследования температурных характеристик образцы были помещены охлаждаемый вакуумный криостат с возможностью установки температуры от 2,7 до 300 К. Регистрация излучения лазерных диодов осуществлялась с помощью монохроматора-спектрографа SOL Instruments MS3504i. Для детектирования излучения образцов применялся охлаждаемый PbSe фотоприемник. Измеренные спектры электролюминесценции образца №606 с диаметром резонатора 100 мкм представлены на рисунке 1.

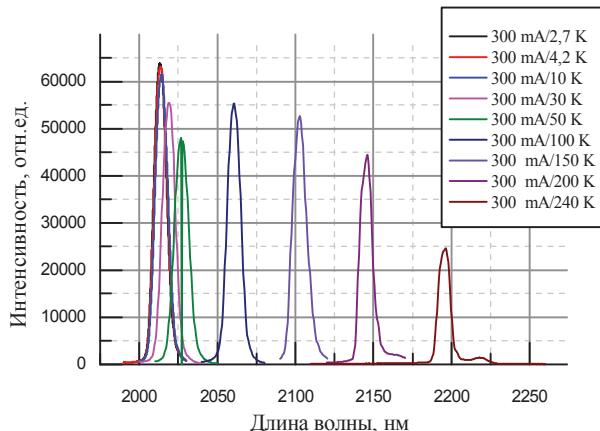


Рисунок 1 - Зависимость спектра электролюминесценции образца номер 606 от температуры, при квазинепрерывном режиме накачки, амплитуда 300 мА, частота следования импульса 16 кГц

Не линейная зависимость интенсивности излучения исследуемого образца от температуры может быть объяснена сложной структурой излучаемой структуры. Более детальное моделирование процессов электролюминесценции и исследование образцов может проводиться с помощью дополнительного моделирования, при этом наличие в полупроводнике примесей и дефектов, характеризующихся мелкими энергетическими уровнями в запрещенной зоне, обуславливает разрешение оптических межзонных переходов без выполнения правил отбора по волновому вектору электрона [1]. Для такого случая спектральная мощность спонтанного излучения в объемных кристаллах описывается соотношением [2]:

$$W_{\text{сп}}(E) = \frac{2e^2 n_0 |\mathbf{M}|^2}{\pi^5 \epsilon_0 \hbar^8 c^3} m_e^{3/2} (m_{hh} + m_{lh})^{3/2} E^2 \times \\ \times \int_{E_g}^E \sqrt{(E - E_g)(E - E_c)} f_e(E_c) f_h(E_c - E) dE_c,$$

где E – энергия фотона; m_e – эффективная масса электрона; m_{hh} – эффективная масса тяжелой дырки; m_{lh} – эффективная масса легкой дырки; n_0 – показатель преломления активного слоя; ϵ_0 – электрическая постоянная; c – скорость света в вакууме; \hbar – редуцированная постоянная Планка; $|\mathbf{M}|^2$ – квадрат матричного элемента межзонных оптических переходов в модели без выполнения правил отбора по волновому вектору, усредненный по поляризациям и направлениям распространения излучения; $f_e(E)$ – функция Ферми–Дирака для электронов; $f_h(E)$ – функция Ферми–Дирака для дырок; F_e и F_h – положения квазиуровней Ферми в зоне проводимости и валентной зоне соответственно; E_c – энергия состояния в зоне

проводимости.

Оценка зависимости ширины запрещенной зоны от температуры исследуемых структур по измеренным спектрам излучения проводилась следующим способом: построением зависимости положения максимума спектра излучения от температуры с поправкой (в длинноволновую область) на $kT/2$ [3], где k – постоянная Больцмана. Для установления зависимости ширины запрещенной зоны исследуемых образцов от температуры необходимо экспериментально определить положение максимумов спектров электролюминесценции образцов при различных температурах. После чего зависимость положения максимумов спектров электролюминесценции в эВ, с поправкой на $kT/2$, аппроксимируется формулой Варшни [4]:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T}$$

где $E_g(0)$ – ширина запрещенной зоны при температуре $T = 0$ К, α и β – параметры Варшни. Оцененные параметры Варшни для исследуемого образца 606: $E_g(0) = 0,616$ эВ, $\alpha = 3,44 \cdot 10^{-4}$ эВ/К, $\beta = 245,87$ К.

Работа частично поддержана грантом БРФФИ № Ф18Р-121 и грантом РФФИ № 18-52-00027.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Температурная зависимость внутренних параметров дисковых лазерных диодов InAs/InAsSbP / В. В. Кабанов [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2009. – Т. 43, № 4. – С. 522–526.
- 2 Suhara, T. Semiconductor laser fundamentals / T. Suhara. – New York: Marcel Dekker, Inc., 2004. – 306 p.
- 3 Электролюминесцентные характеристики светодиодов среднего ИК-диапазона на основе гетероструктур InGaAsSb/GaAlAsSb при высоких рабочих температурах / А. А. Петухов [и др.] // Журнал технической физики. – 2011. – Т. 81, № 4. – С. 91–96.
- 4 Temperature dependence of the energy and broadening parameter of the fundamental band gap of GaSb and Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}/GaSb (0.07 ≤ x ≤ 0.22, 0.05 ≤ y ≤ 0.19) quaternary alloys using infrared photoreflectance / M. Munoz [et al.] // Physical review B. – 2000. – Vol. 62, № 24. – P. 600–604.